BL47XU 光電子分光・マイクロCT

BL47XUは標準アンジュレータを光源とし、液体窒素冷 却二結晶分光器を用いた単色X線ビームラインである。主 として硬X線光電子分光とマイクロCTの二つの手法を用 いた利用実験に供されている。

1. 硬X線光電子分光

BL47XUの硬X線光電子分光 (Hard X-ray Photoemission Spectroscopy: HAXPES) 装置は、バルク敏感性を生かし、 埋込まれた界面における化学結合状態の非破壊観測を目的 とした実験ステーションである。本年度も本特徴を十分に 活かしたユーザー利用が活発に行われ、円滑に支援が行わ れた。特に産業利用におけるHAXPESは前年度から BL46XUでもユーザー利用展開されるに至り、新規ユーザ ーの増大など大きな広がりを見せている。また12条課題と してJSTによる支援を受けた研究 (2005-2009年度、3次 元化学状態走査硬X線光電子顕微鏡装置の開発:研究代表 者 小林啓介 (NIMSビームステーション長))が行われ た。本報告では、本年度までに実施した測定技術開発につ いて示す。

1-1 開発の概要

空間分解能1 μmの集光X線を利用した微小領域計測お よび、さらなるハイスループット、角度分散情報の総取得 を可能にする硬X線光電子分光法の測定技術開発を行って いる。また利用展開を広げるだけではなく、本開発装置を 利用した角度分解型光電子計測を通じ、新たな現象を探索 することを目的としている。

カークパトリック・バエズ(Kirkpatrick-Baez: K-B)配 置型集光ミラーを用いた集光X線を利用した研究ではデバ イス上に作製された微細パターン(反応する電極、基板を 井戸化することにより高集積化を図るSi-LSI多層薄膜等) の走査計測法を開発してきた。また角度分解型光電子測定 を利用した研究では、光電子の脱出角依存を利用した深さ 方向計測を一度に行う広い捕集立体角を持った広角対物レ ンズ装置の開発を行ってきた。開発した広角対物レンズと K-B集光X線技術を組み合わせ、試料を2次元走査する事 により微細パターンをもつ試料の測定角度を変えずに分析 し、深さ方向の化学状態分布を取り込んだ3次元化学結合 状態マッピングが可能となる^[1-1]。図1-1に広角対物レンズ とK-Bミラーを総合的に組み合わせ、評価実験を行った際 の全体写真と概要図を示す。



図1-1 広角対物レンズとK-Bミラーを総合的に組み合わせたハッチ内全体写真と概要図



図1-2 角度分散の評価結果。角度分散評価スリットを通した2D detector image図

1-2 広角対物レンズの開発

広角対物レンズの開発では既設の光電子分光アナライザ - (VG SCIENTA社製 R-4000、捕集立体角 ± 7°)の前段部 に60°以上の広い捕集立体角を持った広角対物レンズを設 置し、さらなるハイスループット化を実現するとともにア ナライザーを回転させることなく角度分散の情報を取得す る。広角対物レンズの特徴は捕集立体角±35°でWorking Distance (WD) が10 mmと非常に小さい点にある。また 回転楕円形状メッシュを採用し、多段球面メッシュを用い た場合に発生する透過光電子の捕集強度の減少をおさえて いる点が特徴として挙げられる^[1-2]。この回転楕円形状メ ッシュの形状誤差・変化およびWDが球面収差に大きく影 響することが分かり、球面収差に起因するエネルギー分解 能の劣化を小さくする調整を行った結果、従来よりも光電 子捕集強度が2倍程度向上したことを確認した。図1-2に 角度分散を評価した結果を示す。この結果から、±35°の 総捕集立体角が実現していることを確認し、角度分解能を 0.34°と評価した。この評価結果は脱出角依存性から深さ 方向の化学状態分布を知る上で重要な情報である。

HfO₂(4 nm)/SiO₂(1 nm)/Si試料に対して、Si酸化成分 の光電子放出角依存(TOA)について測定した結果から、 試料角度は50°と一定に保ったまま、TOAが75°から25° までの角度を一度に観測できることが分かった。Si 1s基 板ピークで強度を規格化した結果から、表面近傍に酸化膜 成分の顕著な増加を確認でき、試料角度を変えずに放出角 度・深さ情報を一度に取得、観測するに到った。各内殻準 位で抽出した各成分強度の角度依存性を図1-3に示す。こ の結果から放出角度ごとのSiO₂膜厚に関して定量評価を行ったところ、平均膜厚が1.0 nmとHRBSで検証した膜厚と 一致し、試料角における捕集効率の違いを気にすることな く高精度での試料膜厚の定量評価が可能となったことが分 かった(図1-3、表参照)。また一度に多量の角度分散情報 を取り込めることから、データ解析が複雑となることが問 題である。これを解消し、測定最中にも解析を行えるよう に深さ分析の自動システム構築を行っている。

1-3 K-B配置ミラー集光調整システムの導入

K-Bミラーの導入は1 um~サブミクロンのビームサイズ を達成することを目標としている。焦点距離が350 mmのミ ラー作製を本年度に実現し、HAXPES装置から伝わる真空 排気による振動の軽減と配置空間干渉を解消するため、 HAXPES架台と分離させたK-Bミラーシステム架台を新た に開発した。この結果、焦点位置で垂直0.98 µm×水平1.0 µm 程度の集光スポットを実現した。K-Bミラー受光面積制限 により放射光のフラックスが通常の1/5程度に減少する (ミラー長=100 mm、glancing angle=3 mrad)が、上記開 発した広角対物レンズと組み合わせることで、光電子捕集 効率の増大効果により、どちらの構成要素も用いない通常 の光電子捕集強度に比べ0.4倍程度の減少に抑えられるこ とを見出した。これにより効率良く光電子捕集が行えてい ることが分かった。光強度減少については大気圧部(1.5 m程度)の見直しとK-Bシステム全体をHeガスフローする ことを検討し、約1.6倍の強度増加を達成している(図1-1、 写真参照)。本K-Bミラーシステムは2010年度から供用を



図1-3 多層膜試料HfO₂(4 nm)/SiO₂(1 nm)/Siの抽出した各成分強度の角度依存性とSiO₂膜厚定量評価結果(表)。HRBSで検証した膜厚と一致し、高精度での試料膜厚の定量評価が可能となった。

開始する予定である。

これらの開発により、半導体界面における電荷トラップ 密度の深さプロファイルを分析し、電荷トラップを抑制す るプロセス設計指針に貢献できる。また本開発した技術は 適応が広く、電極/絶縁体、電極/強相関酸化物、有機物/ 金属などのデバイス界面構造を分析、およびそれを制御し た新構造素子の提案に貢献できるものと期待される。

参考文献

- [1-1] K. Kobayashi et al.: Nuclear Instrument and Methods in Physics Research A 601 (2009) 32-47.
- [1-2] H. Matsuda et al.: Physical Review E **71** (2005) 066503.

利用研究促進部門 応用分光物性グループ 材料電子状態解析チーム 池永 英司、室 隆桂之

2. マイクロCT

本ビームラインではマイクロビームによる走査型顕微 鏡、μ-回折、μ-XAFS、投影型マイクロCT、さらにより 高分解能を目指したX線結像顕微鏡トモグラフィー等の利 用実験が行われている。本ビームラインの結像顕微鏡はフ レネルゾーンプレート(FZP)を対物レンズとした光学系 である。結像顕微鏡では空間分解能を規定するのは対物レ ンズだけではなく、照明光学系よって結像特性が大きく変 化する。FZP対物レンズでは結像に寄与する一次回折光だ けでなく、ゼロ次や高次、負次数回折が同時に存在するた め、単純な照明系では結像顕微鏡として機能しない。

FZP対物レンズ顕微鏡で可能な照明系としては、off-axis 平行光照明と臨界照明が多く使われている。Off-axis照明の 問題点は、視野内でoptical transfer functionが大きく変化 することである。辺縁部では強いエッジ強調偽像が現れる こともあって、吸収コントラストトモグラフィーには適し ていない。臨界照明は多くの第二世代放射光軟X線結像顕 微鏡で使われているが、低エミッタンス光源と組み合わせ た場合、視野が非常に狭くなる問題があり、実用的ではな い。低エミッタンス光源に適した照明系としてはNiemann らによって開発されBESSY-IIの軟X線結像顕微鏡で使われ ている回転ミラー光学系によるHollow-cone照明が知られ ている^[2-1]。我々のグループでもこの回転ミラー照明系を 開発したが、装置の複雑さと調整の難しさから、BL47XUの ような多目的ビームラインでは実用的でないと判断せざる を得なかった。そこで回転ミラーに代わる照明系として、 等間隔回折格子を組み合わせたsector condenser zone plate (sector-CZP)を開発して、BL47XUの硬X線結像顕微 鏡に利用している^[2-2]。このsector-CZPは回転ミラー照明と 同様にケーラー照明と等価な照明光学系となり、均一な視 野が得られている。しかしながら、巨視的には均一な視野 であるが、コヒーレンスが良いSPring-8のアンジュレータ 光源では微視的にはスペックルノイズが強く、スッペクル を打ち消すための拡散板が必要であった^[2-2]。拡散板の使 用はビーム強度の損失だけでなく、迷光の原因となるので 望ましくない。そこで、sector-CZPにおける光学特性を保ち つつスペックルノイズを除去して均一な視野を得るため

に、sector-CZPを光軸回りに回転させる照明系を開発した。 図2-1に回転コンデンサー照明を組み込んだ結像顕微鏡 光学系の構成を示す。結晶分光器により単色化されたビー ムはビームラインの全反射ミラーにより高次光を除去して 結像顕微鏡装置に導入される。この全反射ミラーにはビー ム断面を軸対称に成形する役割もある。光源の特性により、 実験ステーション位置では水平1 mmに対し、垂直ビーム サイズは0.5 mm程度である。全反射ミラーを弾性bend機 構により凸円筒面形状にすることよりビーム断面を垂直方 向に拡大し、実験ステーション最上流で約1 mm×1 mm のビーム断面に成形し、直径1 mmのCZPを用いた軸対称 照明を可能としている。

CZP回転機構は図2-1に示すように、He封入したチェン

バー内にCZPを固定し、チェンバー全体を回転ステージで 光軸回りに回転させる構造である。CZPをHe雰囲気中で 用いるのは放射線損傷の低減のためである。回転ステージ はステッピングモーター駆動により最大3回転/秒の任意 速度の定速回転が可能である。安定な視野を得るためには、 露光時間とCZPの回転を同期させる必要がある。露光時間 内に整数倍の回転をする条件が理想的であるが、CT計測 のような連続測定では、露光時間が1回転の時間より短い 場合でも1フレーム毎に1回転の条件を満たせばほとんど 同等の安定性が得られている。

図2-2に回転sector-CZPをによる結像顕微鏡像の一例を示 す。Sector-CZPは周期長400 nm、内接円直径1 mmの八角形 であり、ゾーン材料はタンタル1.6 µm厚である。CZPの一次



図2-1 回転コンデンサー照明系を用いたBL47XUにおける結像顕微鏡/マイクロCTの装置構成



 図2-2 回転多角形コンデンサーゾーンプレート照明系を用いたX線結像顕微鏡像。(a) 試料の無いflat-field image、(b)分解能評価用テストパターンの画像。(b)の画像 はflat-field 補正を行っていない像である。X線エネルギー:8 keV。露光時間:1 秒。コンデンサー回転速度:1回転/秒。

回折のみを取り出すため、センターストップ(直径0.5 mm のハンダ球) と試料直前のダイヤフラム (直径100 μm) を使 用している。対物レンズは直径155 μm、最外線幅100 nm、 8 keVでの焦点距離100 mmであり、ゾーン材料はタンタ ル1 µm厚である。8 keVでのX線光学系の倍率は約70倍で ある。検出器はシンチレータスクリーンと冷却CCDカメ ラ(浜松ホトニクス、C4880-41S)をリレーレンズで結合 した可視光変換型CCD検出器であり、最終的な顕微鏡像 の画素サイズはX線エネルギー8 keVで48 nmであった。 図に示すように殆どムラのない均一な視野が得られてお り、分解能評価用テストパターン(Ta 0.5 um厚)の画像 ではflat-field補正を行うことなく十分な精度の画像が得ら れている。Blank imageに僅かに残っている不均一性は、 検出器であるビームモニタ (AA20)の蛍光面 (P43, powder screen 厚さ10 μm)の粒状性に起因するものと 考えられる。

参考文献

- [2-1] B. Niemann, P. Guttmann, D. Hambach, G. Schneider, D. Weiss and G. Schmahl : AIP CP507 (2000) 440.
- [2-2] Akihisa Takeuchi, Kentaro Uesugi and Yoshio Suzuki, Journal of Physics: Conference Series 186 (2009) 012020.

利用研究促進部門 バイオ・ソフトマテリアルグループ 鈴木 芳生、竹内 晃久 上杉 健太朗、星野 真人